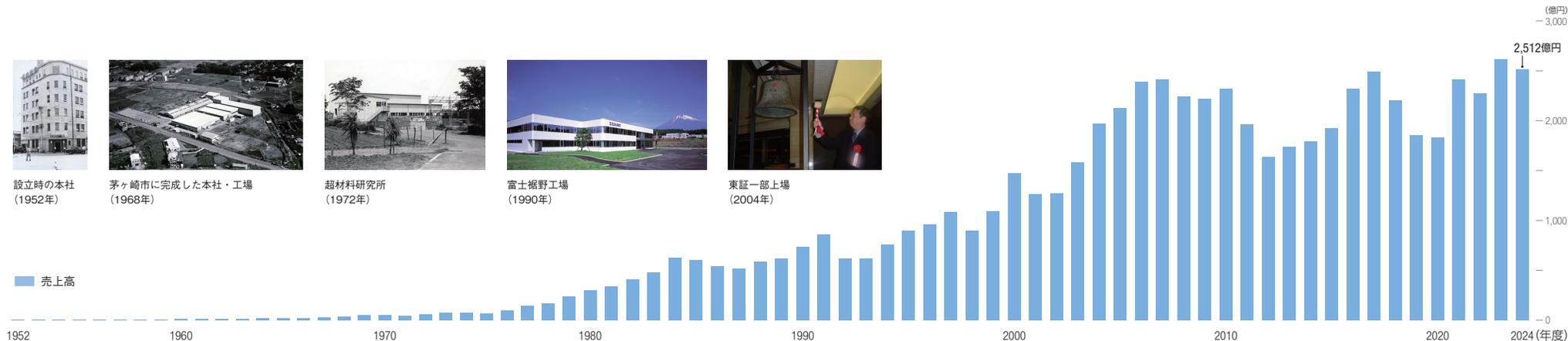


ULVACの軌跡

ULVACは1952年の創業以来、常にコアテクノロジーである最先端の真空技術をもって各時代の社会問題の解決に貢献することで発展を遂げてきました。これからもULVACは経営基本理念に基づき真空技術の総合利用により産業と科学の発展へ貢献し続けます。



■ 売上高



1952～1970年 高度経済成長期

産業の復興・生活を便利に

真空装置で人々の生活を支える産業に貢献

- 1952年 日本真空技術株式会社設立
- 1955年 東京都に大森工場を開設、国産装置の製造に着手
- 1959年 横浜工場開設
- 1964年 初の海外法人を香港に設立
- 1968年 神奈川県茅ヶ崎市に本社・工場竣工

社会問題解決への貢献

- ステンレス鋼など鉄鋼メーカー向け真空アーク炉を開発し産業復興に貢献
- 原子力開発用真空溶解鋳造炉を開発しエネルギー問題の解決に貢献
- 大気汚染の直接分析に使われる高感度真空ガス分析の開発
- 東京大学宇宙研へ大型スペースチャンバを納入し宇宙開発に貢献
- インスタント食品向け真空凍結乾燥装置を開発し食生活の改善に貢献

1971～1990年 エレクトロニクスの発達

働きやすいオフィスを

半導体需要の高まりとともに製品が続々と世界のトップシェアに

- 1972年 アルバック初の研究機関として超材料研究所を開設
- 1975年 対米輸出の拠点として北米に現地法人を設立
- 1982年 台湾に現地法人を設立
- 1983年 中国に北京事務所を開設
- 1990年 半導体製造装置の専門工場として静岡県に富士裾野工場を開設

社会問題解決への貢献

- 日本原子力研究所へ臨界プラズマ試験装置の真空排気システムを納入
- 電卓用液晶ディスプレイ透明導電膜成膜装置を開発
- 半導体メモリ向け世界初マルチチャンバ成膜装置を開発
- IBM社へ半導体向け世界初コンピューター制御真空蒸着装置を納入
- ハードディスク成膜用スパッタリング装置を開発し、コンピューターの性能向上に大きく貢献

1991～2010年 情報化社会・デジタル家電の普及

高性能なデバイスを

FPD市場が日本から韓国・台湾に拡大し、大きく成長

- 2001年 社名を株式会社アルバック(英文名: ULVAC, Inc.)に変更
- 2003年 中国における本格的生産とサービス拠点を設立
- 2004年 東証一部上場/本社・工場(茅ヶ崎市)新社屋完成
- 2005年 材料の開発・製造を担う千葉富里工場を開設

社会問題解決への貢献

- 半導体用マルチチャンバ成膜装置CERAUSシリーズを開発
- 液晶ディスプレイ用スパッタリング装置SMDシリーズを開発し、ラップトップPCの量産に貢献。のちの薄型TV普及の礎となる。
- 次世代ディスプレイとして期待される有機EL成膜装置を開発
- 省電力化に貢献するパワーデバイスの量産対応イオン注入装置を開発
- 省電力を実現したドライポンプ用アタッチメント「ECO-SHOCK」を開発
- 再生可能エネルギーの需要に対応し、薄膜太陽電池一貫製造ラインを開発

2011～現代 デジタル社会

持続可能な未来へ

真空総合メーカーとしての強みを活かし幅広い分野で貢献

- 2018年 大阪大学内にアルバック未来技術協働研究所を開設
- 2021年 東京科学大学内にアルバック先進技術協働研究拠点を開設
- 2022年 東証プライム市場に上場
- 2024年 韓国にTechnology Center PYEONGTAEKを設立

社会問題解決への貢献

- 真空蒸着技術活用の薄膜リチウム金属負極の開発がNEDO*グリーンイノベーション基金事業「次世代蓄電池・次世代モーターの開発」プロジェクトに採択
- 大阪大内のアルバック未来技術協働研究所において、再生医療・エネルギー分野などの基礎研究や国内初企業共創講座として学生受け入れを実施
- 東京科学大学内のアルバック先進技術協働研究拠点にて、プラズマ測定技術とAI技術の融合や人材育成など共創を目指す
- EUV(極端紫外線)対応のMHM(メタルハードマスク)用スパッタリング装置を開発し、高速、低消費電力の先端ロジック量産に貢献

*国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構